

تأثیر عملیات حرارتی روی ساختار، میکروسختی و رفتار خوردگی پوشش‌های الکترولیس Ni-P ایجاد شده بر روی آلیاژ Al 5083

سعید احمدی‌زاده، سید محمود منیرواقفی و احمد ساعتچی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این کار، پوشش‌های الکترولیس Ni-P با ضخامت تقریبی ۲۰ میکرون و مقدار فسفر متوسط ۶/۷۳ درصد وزنی، روی زیرلایه Al5083 ایجاد شدند و تأثیر عملیات حرارتی روی ساختار، میکروسختی و رفتار خوردگی این پوشش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این پوشش‌ها در محدوده دمایی ۲۰۰ تا ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد و به مدت یک ساعت حرارت داده شدند. مشخصات ساختاری پوشش‌ها توسط آنالیز اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش اولیه، بازتاب‌های پنهانی از پرتو ایکس را که بیان کننده یک ساختار نیمه آمورف است، از خود نشان می‌دهد. عملیات حرارتی، فاز آمورف را کاهش می‌دهد و فازهای تعادلی نهایی، کریستال‌های Ni_3P و Ni به ترتیب با اندازه‌های ۳۲ و ۱۸ نانومتر هستند. نتایج آزمایش میکروسختی ویکرز نیز نشان داد که پس از عملیات حرارتی در دمای ۲۰۰ °C، سختی کاهش می‌یابد و ماکریتم سختی برای نمونه‌هایی که در دمای ۴۰۰ °C عملیات حرارتی شدند حاصل می‌شود. دلیل این امر، تشکیل فاز پایدار بین فلزی Ni_3P در این دما می‌باشد که باعث رسوب سختی می‌گردد. مقاومت به خوردگی پوشش‌ها در محلول ۳/۵ wt.% NaCl ۳/۵ توسط روش‌های پلاریزاسیون پتانسیوپلیستیک و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مربوطه نشان داد که با عملیات حرارتی تا دمای ۲۴۰ °C، مقاومت به خوردگی افزایش و سپس در دماهای بالاتر کاهش می‌یابد. عملیات حرارتی در ۴۰۰ °C منجر به کریستال‌شدن فاز آمورف و افزایش تعداد مرزدانه‌های موجود که بسیار مستعد به خوردگی هستند می‌شود. بنابراین عملیات حرارتی نمونه‌های الکترولیس در ۴۰۰ °C مقاومت به خوردگی آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

کلمات کلیدی: پوشش‌های الکترولیس Ni-P، عملیات حرارتی، خوردگی، ساختار، میکروسختی.

The effects of heat treatment on structure, microhardness and corrosion behavior of electroless Ni-P deposits on Al 5083 alloy

S. Ahmadizadeh, S.M. Monir Vaghefi and A. Saatchi

Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

Abstract: In this work, electroless Ni-P deposits, of approximately 20 μm in thickness and a medium phosphorous content, of approximately 6.73 wt.%, were obtained on Al5083 substrate and the effects of heat treatment on structure, microhardness and corrosion behavior of the deposits were investigated. Deposits were heated at temperatures ranging from 200 to 400 °C for 1 h. The structural characterization was done by means of X-ray diffraction studies. As-deposited coating exhibit broadened X-ray reflections indicative of a semi-amorphous structure. Heat treatment decreased the amorphous phase and after heat treatment at 400 °C for 1 h, the final equilibrium phases were Ni_3P and Ni crystals with size of 32 and 18 nm, respectively. The results of Vickers microhardness testing showed that after heat treatment at 200 °C, the hardness decreases and the maximum hardness was achieved for the samples which have been heat treated at 400 °C. This is caused by the formation of intermetallic Ni_3P stable phase at this temperature, acting as a function of precipitation hardening. Corrosion resistance of the coatings was evaluated in 3.5 wt.% NaCl solution by potentiodynamic polarization and electrochemical impedance (EIS) methods. The fitting results indicated that on heating to 240 °C, the corrosion resistance increased and then reduced at higher temperatures. Heat treatment at 400 °C leads to crystallization of the amorphous phase, making available more number of grain boundaries which are highly prone to corrosion attack. Therefore, the heat treatment of electroless specimens at 400 °C significantly decreases their corrosion resistance.

Keywords: Ni-P electroless deposits; Heat treatment; Corrosion; Structure; microhardness.

E-mail of corresponding author (s): saeed_ahmadizadeh@yahoo.com

شده از ساختار آمورف، به قیمت از دست دادن مقاومت به خوردگی آنها به دست می‌آید [۸]. بنابراین لازم شد که بررسی‌های بیشتری روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های نانوکریستالی ایجاد شده توسط آبکاری الکترولیس صورت بگیرد.

غالباً ایجاد پوشش‌های الکترولیس Ni-P روی آلیاژ‌های آلومینیم، ترکیب خوبی از خواص مختلف (دانسیته پائین و استحکام قابل قبول) را در آن ایجاد می‌کند. به علاوه، توسط عملیات حرارتی، می‌توان سختی این پوشش‌ها را بیش از این افزایش داد [۱۰]. هدف این کار، مطالعه تأثیر عملیات حرارتی روی ساختار، میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش‌های الکترولیس Ni-P در محلول wt.\% NaCl در محلول wt.\% NaCl باشد.^{۳/۵}

مواد و روش تحقیق

این تحقیق، روی نمونه‌های ورق آلومینیمی آلیاژ ۵۰۸۳ به عنوان زیرلایه با ترکیب (wt.%): Mg_{۰/۵}, Mn_{۵/۴۱}, Si_{۰/۱۵}, Cr_{۰/۰۹}, Zn_{۰/۰۷}, Cu_{۰/۰۹}, Fe_{۰/۰۵۲} انجام شد. اندازه نمونه‌ها $25 \times 25 \times 6$ میلی‌متر بود. بقیه Al انجام شد. اندازه نمونه‌ها $25 \times 25 \times 6$ میلی‌متر بود. مراحل آماده سازی زیرلایه قبل از آبکاری عبارتند از: پولیش با کاغذ سنبله SiC تا درجه ۱۲۰۰، گریس زدایی، شستشوی قلیایی در محلول Na_2CO_3 ۴۰٪ در دمای $60 \pm 5^\circ\text{C}$ به مدت ۲ تا ۳ دقیقه، شستشو با آب سرد، اسیدشویی در محلول H_2SO_4 ۵۰٪ به مدت ۳۰ ثانیه، شستشو با آب سرد و زینکاته کردن به مدت یک دقیقه در محلولی شامل هیدروکسید سدیم (NaOH)، سولفات روی ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) و تارتارات پتاسیم سدیم و در دمای اتاق ($25 \pm 5^\circ\text{C}$). عملیات زینکاته به منظور حذف فیلم اکسیدی تشکیل شده پس از شستشوی قلیایی و اسید شویی و جلوگیری از اکسیداسیون مجدد و ایجاد سطح کاتالیتیکی که برای آبکاری الکترولیس نیکل ضروری است انجام می‌گردد.

مقدمه

آلومینیم و آلیاژ‌های آن امروزه به دلیل سبکی، نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خوردگی بالا، کاربردهای بسیاری دارند، اما محدودیت‌ها و معایبی دارند که از آن جمله می‌توان نرمی و مقاومت سایشی پائین آنها را نام برد [۱۰-۲]. روش‌های عملیات سطحی، فرایندهای خوبی برای غلبه بر این کمبودها هستند که از این بین می‌توان آبکاری الکترولیس را نام برد که روش مناسبی برای ایجاد پوشش‌های آلیاژی آمورف یا غیرآمورف می‌باشد [۱]. آلیاژ‌های الکترولیس نیکل از زمانی که توسط برنر^۱ و ریدل^۲ در سال ۱۹۴۴ ابداع شدند بواسطه خواص بی‌نظیرشان مانند مقاومت سایشی و خوردگی، لحیم پذیری و یکنواختی ضخامت پوشش، مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از صنایع به کار گرفته شدند [۳-۱۰]. پوشش‌های الکترولیس Ni-P بر اساس مقدار فسفرشان معمولاً به سه طبقه فسفر کم (P<۱-۵ wt.%)، فسفر متوسط (۵-۸ wt.% P) و فسفر زیاد (P>۹ wt.% و بیشتر) تقسیم بندی می‌شوند [۷]. مطالعات نشان می‌دهد که پوشش‌های اولیه با مقدار متوسط فسفر، ترکیبی از فازهای آمورف و نانوکریستالی نیکل می‌باشند [۱۰-۸]. آلیاژ‌های آمورف نانوکریستالی نیکل می‌باشند [۱۰-۹]. آلیاژ‌های آمورف Ni-P از لحاظ ترمودینامیکی ناپایدار بوده و در اثر عملیات حرارتی کریستاله شده و در نهایت، کریستال‌های پایدار نیکل با ساختار fcc و ترکیبات فسفید نیکل (Ni_۳P) با ساختار bct شکل می‌گیرند [۴]. اندازه دانه، تابعی از دما و زمان آنلیست و در پوشش‌هایی با مقدار متوسط فسفر، اندازه نهایی دانه در محدوده اندازه نانوکریستالی می‌باشد [۹].

مواد نانوکریستالی به دلیل اندازه بسیار کم دانه و زیاد بودن کسر حجمی مرزدانه و محلهای اتصال سه گانه‌شان، خواص مکانیکی، شیمیایی و الکتریکی غیر معمولی را از خود نشان می‌دهند. از طرفی تصور می‌شود که مقاومت سایشی بالای پوشش‌های الکترولیس نانوکریستالی ایجاد

^۱- Brenner

^۲- Riddell

M الکتروودی استاندارد شامل یک الکترود مرجع Ag/AgCl ، $3/5\text{KCl}$ و یک سیم پلاتینی به عنوان الکترود شاهد انجام گردید. مساحت سطحی از نمونه که در معرض محیط خورنده قرار داشت تقریباً ۲ سانتی‌متر مربع بود. تست پتانسیوودینامیک، با استفاده از یک سیستم پتانسیواستات/گالوانواستات EG&G 263A و با نرخ 1 mV/s^6 انجام شد. تست EIS نیز با استفاده از دستگاه EG&G AC responder 1025 متصل شده به EG&G 263A یک سیستم پتانسیواستات/گالوانواستات و در محدوده فرکانس بین 10 KHz تا $0/01 \text{ Hz}$ انجام گردید. قبل از شروع اندازه گیری‌های EIS، به منظور برقراری پتانسیل مدار باز (E_{OCP} ، نمونه‌ها به مدت ۳۰ دقیقه در محیط خورنده قرار داده شدند. پتانسیل خوردگی (E_{corr}) و دانسیته جریان خوردگی (i_{corr}) با استفاده از روش بروونیابی تافل^۷ تعیین شدند. مقاومت انتقال بار (R_{ct}) و ظرفیت لایه دوگانه (C_{dl}) نیز از منحنی‌های PowerSuite^۸ و با استفاده از نرم افزار اندازه‌گیری شدند.

یافته‌ها و بحث

۱-۳-۱- ترکیب، ضخامت و مورفولوژی پوشش‌ها (EDS/SEM) مشخص گردید که پوشش‌های اولیه دارای میانگین فسفر $6/73$ درصد وزنی می‌باشند. همچنین ضخامت پوشش‌ها از طریق تصاویر SEM از سطح مقطع نمونه‌های پوشش شده تعیین شد و مشخص گردید که تمام پوشش‌ها دارای ضخامت تقریبی $20 \mu\text{m}$ می‌باشند. تصویر SEM سطح پوشش اولیه، در شکل ۱ نشان داده شده است. مورفولوژی سطح پوشش اولیه، یک طرح کروی^۹ به همراه یک ساختار گل کلمی^{۱۰} شکل را نشان می‌دهد. مشاهدات مشابهی در نوشهای وجود دارد [۱۱ تا ۱۳].

⁶- Scan Rate

⁷- Tafel Extrapolation Method

⁸- Nyquist

⁹- Nodular Feature

¹⁰- Cauliflower-like Structure

حمام مورد استفاده برای ایجاد پوشش‌های الکتروولس، شامل 40 g/l سولفات نیکل، 20 g/l هیپوفسفیت سدیم و 10 g/l سیترات سدیم می‌باشد. شرایط انجام فرایند آبکاری عبارتند از: $\text{pH} 4/7$ ، 90°C و زمان آبکاری ۲ ساعت.

نمونه‌های پوشش داده شده، به منظور عملیات حرارتی، در یک کوره خشی از پیش گرم شده در دماهای مختلف عملیات حرارتی ($200-400^\circ\text{C}$) و به مدت یک ساعت قرار داده شده و پس از عملیات حرارتی، در کوره سرد شدند. سختی پوشش‌ها توسط یک آزمایش گر میکروسنتمتی ویکرز (مدل Leitz Wetzlar) با بار 50 g و زمان 20 ثانیه اندازه‌گیری شد. سختی هر پوشش، 5 بار اندازه‌گیری و میانگین آنها ثبت گردید.

میکروساختار پوشش‌ها، توسط پراش پرتو ایکس (XRD) و استفاده از دستگاه Philips X'pert MRD مونوکروماتیک (Cu-K α) مورد بررسی قرار گرفت. محدوده زاویه روبشی^۱ (2θ) از 30° تا 80° با اندازه گام^۲ $0/03^\circ$ و زمان محاسبه^۳ 1 sec/step انتخاب گردید. مورفولوژی سطح پوشش اولیه^۴ با استفاده از SEM model Philips میکروسکوپ الکترونی روبشی (XL30) مشخص شد. همچنین ضخامت پوشش‌ها از طریق تصاویر SEM از سطح مقطع نمونه‌های پوشش شده شده که به دقت جهت متالوگرافی آماده سازی شده بودند اندازه‌گیری گردید. ترکیب شیمیابی پوشش اولیه Ni-P نیز توسط دستگاه EDS (مدل Tescan Vega) در انرژی پرتو^۵ 20 keV تعیین شد.

رفتار خوردگی، با استفاده از تکنیک پتانسیوودینامیک و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیابی (EIS) مورد بررسی قرار گرفت. تست‌های الکتروشیمیابی در محلول $3/5 \text{ wt.\% NaCl}$ و با استفاده از یک پیل سه

¹- Scanned Angle

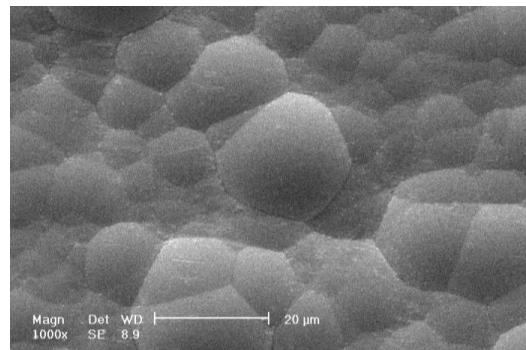
²- Step Size

³- Counting Time

⁴- As-deposited Coating

⁵- Beam Energy

۳۶۰ °C و ۳۲۰ °C، ۲۸۰ °C پیک بلند مربوط به صفحه {111} Ni دو پیک ضعیف مربوط به صفحات {۲۰۰} Ni و {۲۲۰} Ni که همه آنها روی یک پیک پهن مربوط به فاز آمورف قرار گرفته اند وجود دارد. بنابراین تغییر مشاهده شده تا دمای ۳۶۰ °C محلود به تیز شدن و افزایش شدت پراش‌های نیکل است و این نتایج، بیانگر انجام کریستالیزاسیون جزئی و بزرگ شدن دانه‌های fcc نیکل از قبل موجود می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش دمای آنیل، شدت پیک {۲۰۰} Ni با سرعت بیشتری نسبت به شدت پیک {۱۱۱} Ni افزایش می‌یابد. حرارت دادن در دمای ۴۰۰ °C و به مدت یک ساعت، منجر به تیزتر شدن و افزایش شدت بازتاب‌های نیکل و همچنین رسوب فسفید نیکل (Ni_3P) و نمایان شدن پیک‌های آن در محدوده ۲۰-۴۰ wt.% P (۵-۸ wt.% P)، ترکیبی از فازهای آمورف و نانوکریستالی نیکل هستند [۱۰]. بنابراین ساختار پوشش اولیه [۱۱۱] Ni-۶/۷۳ (Ni-6/73) نه کاملاً آمورف است و نه اینکه کاملاً نانوکریستالی است بلکه ترکیبی از فازهای آمورف و $Ni-P$ نانوکریستالی می‌باشد. در رابطه با پوشش اولیه $Ni-P$ پیک نشان داده شده، از روی هم قرار گرفتن یک پیک تیز و یک پیک زمینه پهن در ۲۰ بین ۳۵ تا ۵۵ درجه بدست آمده است. پیک تیز مربوط به پراش $\{111\}$ فاز نانوکریستالی نیکل و پیک زمینه پهن مربوط به فاز آمورف پوشش می‌باشد. پیک‌های {۲۰۰} Ni و {۲۲۰} Ni نیز به $Ni-P$ نانوکریستالی نیکل می‌باشند. دلیل وجود فاز نانوکریستالی نیکل می‌تواند در نمونه پراش مشاهده گردند. دلیل این موضوع ممکن است درصد بسیار کم فاز نانوکریستالی موجود در پوشش و اندازه دانه بسیار کوچک آنها باشد که منجر به ناپدید شدن پیک های $Ni-P$ و Ni در پوشش اولیه Ni و $Ni-P$ می‌گردد. عملیات حرارتی تا دمای ۲۴۰ °C تأثیری روی بازتاب‌های $\{200\}$ Ni و $\{220\}$ Ni ندارد و در این حالت، افزایش اندکی در شدت $\{111\}$ Ni مشاهده می‌شود. برای پوشش‌های حرارت داده شده در دماهای



شکل ۱. تصویر SEM سطح پوشش اولیه کتروولس Ni-P

آنالیز XRD

شکل ۲، پروفیل‌های XRD پوشش‌های کتروولس $Ni-P$ آنیل شده در دماهای مختلف و زمان یک ساعت را در شرایط ایروترمال نشان می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهند که پوشش‌های اولیه با مقدار فسفر متوسط (۵-۸ wt.% P) ترکیبی از فازهای آمورف و نانوکریستالی نیکل هستند [۱۰]. بنابراین ساختار پوشش اولیه

کاملاً آمورف است و نه اینکه نانوکریستالی است بلکه ترکیبی از فازهای آمورف و $Ni-P$ نانوکریستالی می‌باشد. در رابطه با پوشش اولیه $Ni-P$ پیک نشان داده شده، از روی هم قرار گرفتن یک پیک تیز و یک پیک زمینه پهن در ۲۰ بین ۳۵ تا ۵۵ درجه بدست آمده است. پیک تیز مربوط به پراش $\{111\}$ فاز نانوکریستالی نیکل و پیک زمینه پهن مربوط به فاز آمورف پوشش می‌باشد. پیک‌های {۲۰۰} Ni و {۲۲۰} Ni نیز به $Ni-P$ نانوکریستالی نیکل می‌باشند. دلیل وجود فاز نانوکریستالی نیکل می‌تواند در نمونه پراش مشاهده گردد. دلیل این موضوع ممکن است درصد بسیار کم فاز نانوکریستالی موجود در پوشش و اندازه دانه بسیار کوچک آنها باشد که منجر به ناپدید شدن پیک های $Ni-P$ و Ni در پوشش اولیه Ni و $Ni-P$ می‌گردد. عملیات حرارتی تا دمای ۲۴۰ °C تأثیری روی بازتاب‌های $\{200\}$ Ni و $\{220\}$ Ni ندارد و در این حالت، افزایش اندکی در شدت $\{111\}$ Ni مشاهده می‌شود. برای پوشش‌های حرارت داده شده در دماهای

آزمایش میکروسختی

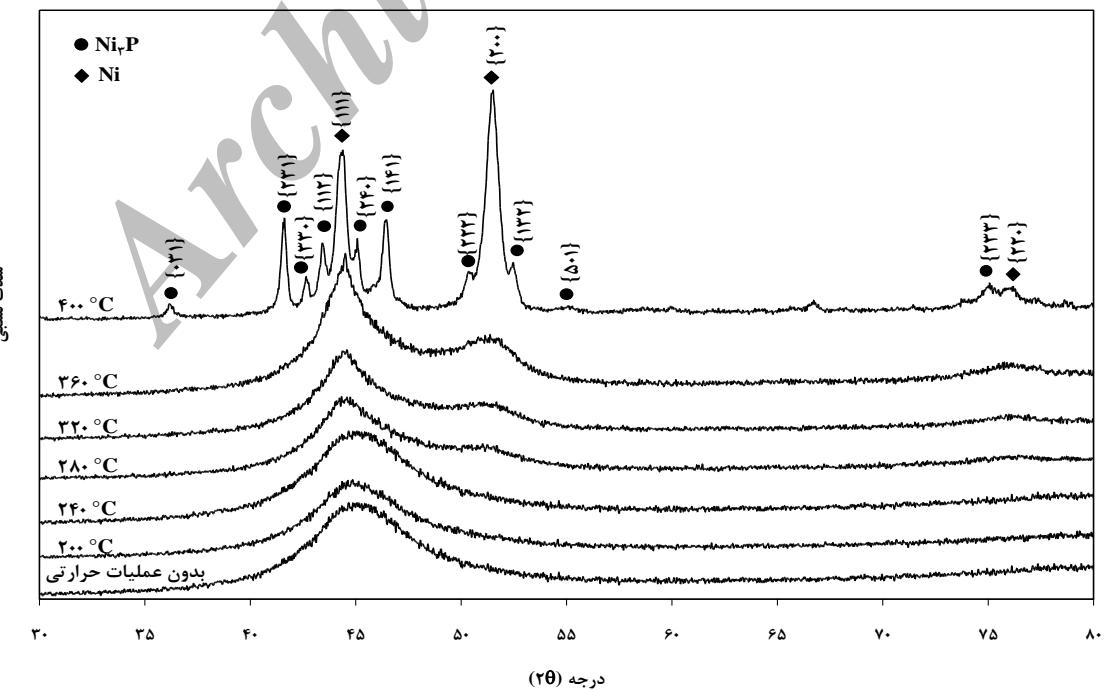
میکروسختی پوشش‌های Ni-P به عنوان تابعی از دمای عملیات حرارتی، در شکل ۳ نشان داده شده اند. میانگین میکروسختی پوشش اولیه، HV_{0.05} ۵۹۳ است که تقریباً معادل با سیاری از فولادهای آلیاژی سخت شده می‌باشد. پس از اینکه پوشش Ni-P در دمای ۲۰۰ °C حرارت داده شد سختی آن به حدود HV_{0.05} ۵۷۶ کاهش پیدا می‌کند.

سختی بیشتر پوشش‌های تجاری کروم سخت برساند.

رفتار خوردگی

منحنی‌های پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک پوشش‌های الکتروولس Ni-P اولیه و همچنین عملیات حرارتی شده، در محلول $3/5$ wt.% NaCl در شکل ۴ مشاهده می‌شوند. پتانسیل خوردگی (E_{corr}) و دانسیته جریان خوردگی (i_{corr}) با استفاده از روش برونویابی تافل، اندازه‌گیری و درجول آورده شدند. همچنین منحنی‌های $3/5$ wt.% NaCl در محلول در پتانسیل مدار بازشان^۱ در شکل ۵ نشان داده شده‌اند. منحنی‌های نایکوئیست تمام پوشش‌ها، یک نیم دایره در محدوده فرکانسی مطالعه شده (۰.۰۱ Hz تا ۱۰ KHz) نشان می‌دهند اما اندازه این نیم دایره‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین فرایندی که روی تمام انواع پوشش‌های Ni-P روی می‌دهد یکسان بوده اما در هر مورد، مساحت مؤثر، متفاوت است. یک مدل مدار الکتریکی معادل در شکل ۶ نشان داده شده است که به منظور شبیه‌سازی فصل مشترک

این امر نه تنها می‌تواند به دلیل حذف عیوب نقطه ای و نابجایی‌های داخل دانه‌ها و مناطق مرزدانه باشد بلکه ممکن است به دلیل رشد دانه‌های نانوکریستالی نیکل (شکل ۲) و همچنین به دلیل جدایش فسفر در مرزدانه ها نیز باشد. عملیات حرارتی از 240°C تا 360°C باعث افزایش سختی و رسیدن مقدار آن به حدود $712\text{ HV}_{0.05}$ می‌گردد که نشان دهنده کریستالیزاسیون جزئی و در نتیجه پیدایش عیوب مختلف کریستالی مربوط به آن می‌باشد. پس از اینکه پوشش در دمای 400°C عملیات حرارتی شد سختی آن به شدت افزایش می‌یابد و به حدود $716\text{ HV}_{0.05}$ مطالعات نشان می‌دهند که این افزایش سختی مربوط به رسوب فاز پایدار بین فلزی Ni_3P در طی کریستالیزاسیون فاز آمورف می‌باشد [۱۶ تا ۱۸]. گزارش شده است که فاز Ni_3P استحکام و مدول برخی بالایی دارد که باعث اثرگذاری روی سختی این پوشش‌ها می‌شود [۱۶ و ۱۷]. این مشاهدات، با نتایج آنالیز XRD (شکل ۲) سازگاری دارند. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که عملیات حرارتی پوشش‌های الکتروولس Ni-P می‌تواند سختی آنها را به

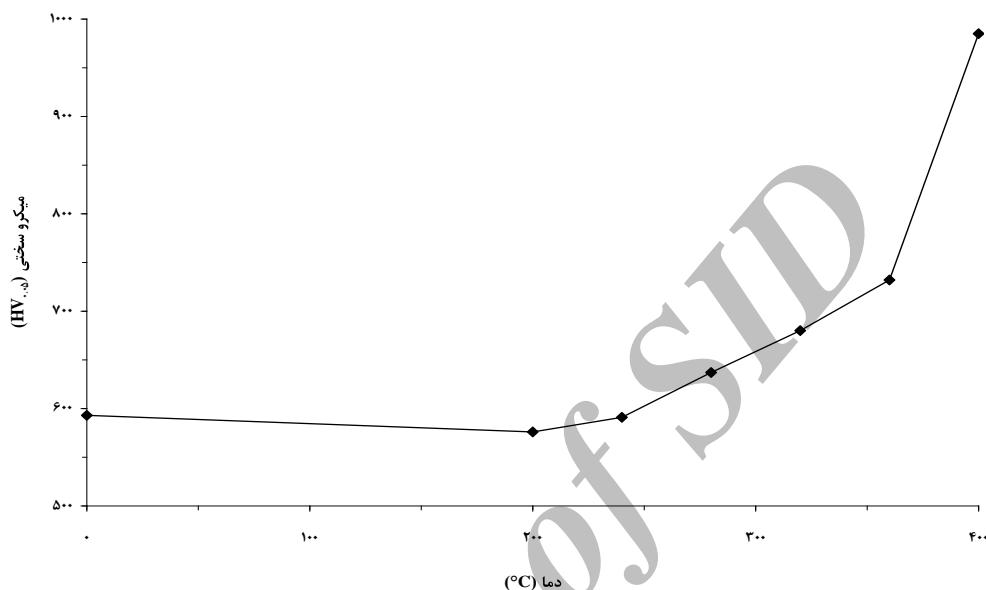


شکل ۲. نمونه پراش پرتو ایکس پوشش‌های اولیه و عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف و زمان یک ساعت.

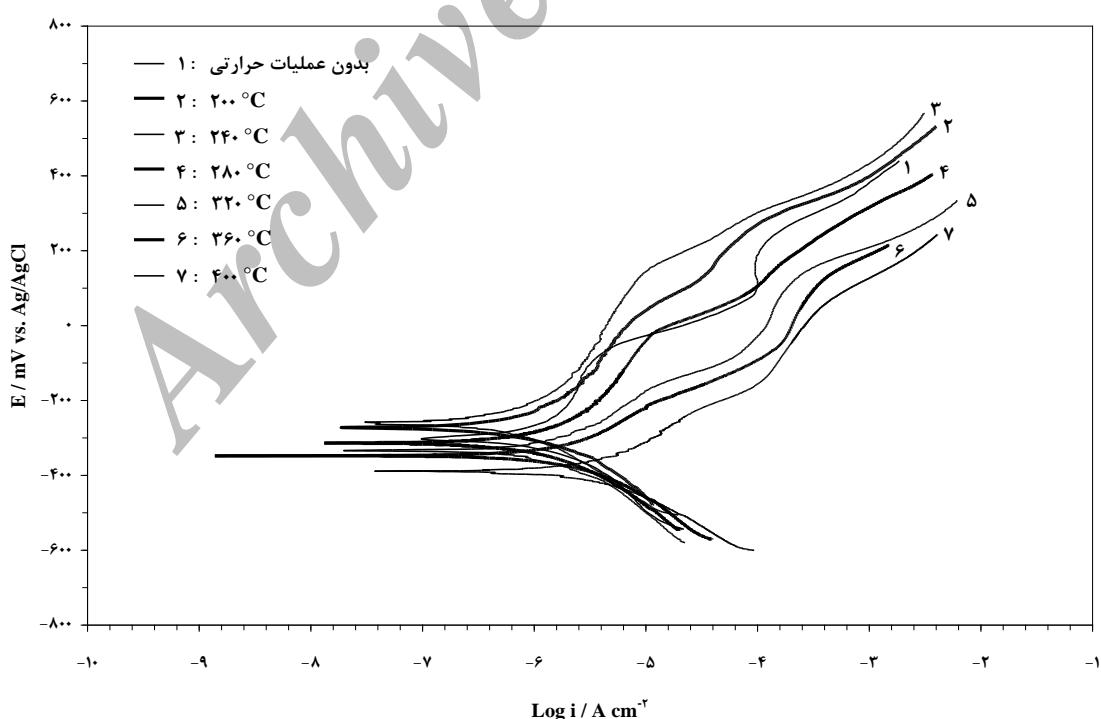
^۱- Open Circuit Potential

نوک لاغین^۱ سری هستند. نارایانان و همکارانش [۱۴]، کوئی و همکارانش [۶] و بالاراجو و همکارانش [۱۹] نیز مدل مشابهی را به منظور مطالعه رفتار الکتروشیمیایی پوشش‌های الکتروولس Ni-P در محلول wt.\% NaCl در محلول

فلز/ محلول و همچنین تحلیل داده‌های بدست آمده استفاده می‌شود. این مدار شامل یک ظرفیت لایه دوگانه (C_{dl}) است که موازی با مقاومت انتقال بار (R_{ct}) می‌باشد و هر دوی اینها با مقاومت محلول بین الکترود کاری (WE) و



شکل ۳. میکروسختی و یکرز پوشش‌های اولیه و عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف و زمان یک ساعت.



شکل ۴. منحنی‌های پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک پوشش‌های اولیه و عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف و زمان یک ساعت، در $۳/۵ \text{ wt.\% NaCl}$ محلول

^۱- Luggin

هیچ عنصر سومی که موجب پسیوواسیون شود وجود نداشته باشد، از بین رفتن فاز آمورف و تشکیل ساختار نانو به نوبه خود برای مقاومت به خوردگی پوشش ها مضر خواهد بود.

این نتیجه با تئوری خوردگی کلاسیک سازگار است که می‌گوید ساختار نانو، خوردگی را به دلیل تشکیل بسیاری از پیلهای الکتروشیمیایی میکرو بین مقدار عظیم مرزدانه ها و زمینه تشدید می کند در حالیکه ساختار آمورف، ذاتاً مقاومت به خوردگی بالایی را به دلیل همگن بود ن بسیار زیاد ساختارش که عاری از مسیرهای ترجیحی خوردگی مانند مرزها یا دیگر عیوب ساختار است از خود نشان می دهد. بنابراین عملیات حرارتی در دمای بالا تنها زمانی می‌تواند ترجیح داده شود که مقاومت به خوردگی، در درجه اول دارای اهمیت نباشد.

گزارش شده که فیلم هیپوفسفیت چسبنده که در نتیجه غنی سازی فسفر سطح تشکیل می شود نقش مهمی را در بهبود مقاومت به خوردگی پوشش Ni-P ایفا می کند چرا که سطح را ایزوله کرده و از واکنش های سطح با مولکول های آب جلوگیری می کند [۱۴ و ۱۵ و ۱۶]. عملیات حرارتی در ۴۰۰ °C به مدت یک ساعت به تشکیل Ni₃P منجر می شود (شکل ۲) که به نفوذ فسفر کمک می کند. این فرایند نفوذ ممکن است پایداری فیلم هیپوفسفیت چسبنده را کاهش دهد. بنابراین از بین رفتن این لایه چسبنده نیز ممکن است سبب کاهش بیشتر در مقاومت به خوردگی پوشش گردد.

نتیجه‌گیری

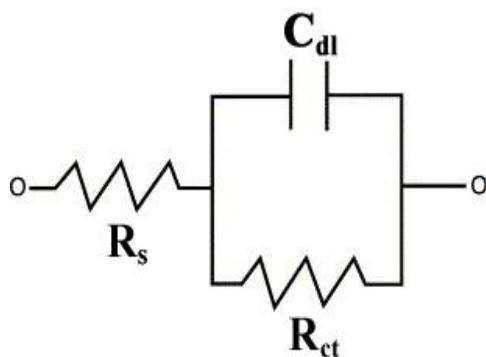
تأثیر عملیات حرارتی روی ساختار، میکروسختی و رفتار خوردگی پوششهای الکتروولس Ni-P ایجاد شده روی زیرالایه Al5083، با مقدار فسفر متوسط، مورد بررسی و تحقیق واقع شد. نتایج نشان دادند که:

۱. مورفولوژی سطح پوشش های اولیه، یک طرح کروی به همراه یک ساختار گل کلمی شکل را نشان می دهد.

۳/۵ مورد استفاده قرار دادند . پیدایش یک نیم دایره در منحنی های نایکوئیست نشان می دهد که فرایند خوردگی پوشش های الکتروولس Ni-P درگیر تنها یک ثابت زمانی است. بنابراین مشخص است که فصل مشترک پوشش/ محلول رفتار انتقال بار نشان می دهد. مقادیر مقاومت انتقال بار (R_{ct}) و ظرفیت لایه دوگانه (C_{dl}) پوشش ها ، از روی منحنی های نایکوئیست و با استفاده از نرم افزار PowerSuite اندازه‌گیری و در جدول ۱ آورده شده‌اند. نتایج مطالعات امپدانس الکتروشیمیایی، یک روند مشابه با مطالعات پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک را در رابطه با مقاومت به خوردگی نشان می دهند.

مشاهده می شود که پس از عملیات حرارتی در دمای ۲۰۰ °C، مقاومت انتقال بار (R_{ct}) افزایش و دانسیته جریان خوردگی (i_{corr}) کاهش می یابد (جدول ۱). بنابراین عملیات حرارتی در دمای ۲۰۰ °C مقاومت به خوردگی پوشش های الکتروولس را بهبود می بخشد که ممکن است به این دلیل باشد که آنلیل کردن می تواند سبب رشد دانه های نانوکریستالی نیکل و آزادسازی تنش های داخلی و حذف عیوب پوشش مانند تخلخل ها، عیوب نقطه ای و نابجایی های داخل دانه ها و مناطق مرزدانه شود . عملیات حرارتی در دمای ۲۴۰ °C باعث افزایش اندکی در مقاومت به خوردگی پوشش می شود (جدول ۱). عملیات حرارتی از ۲۸۰ °C تا ۳۶۰ °C مقاومت به خوردگی را کاهش می دهد که بیانگر کریستالیزاسیون جزئی و در نتیجه پیدایش عیوب مختلف کریستالی مربوط به آن می باشد. عملیات حرارتی در ۴۰۰ °C منجر به کریستالیزاسیون فاز آمورف می شود که در نتیجه، تعداد مرزدانه ها را که بسیار مستعد به خوردگی هستند افزایش می دهد. بنابراین عملیات حرارتی نمونه های الکتروولس در ۴۰۰ °C، به شدت مقاومت به خوردگی آنها را کاهش می دهد. کاهش توانایی حفاظت از خوردگی این پوششها، به محض عملیات حرارتی در ۴۰۰ °C با توجه به تغییر پارامترهای خوردگی موجود در جدول ۱ (افزایش i_{corr} و کاهش R_{ct}) به وضوح مشخص است و دلالت بر این دارد که هرگاه

اهش مقاومت به خوردگی پوشش را به شدت ک می‌دهد.



شکل ۶. مدل مدار الکتریکی معادل موردن استفاده جهت آنالیز داده‌های EIS پوشش‌های الکتروولس Ni-P

تشکر و قدردانی

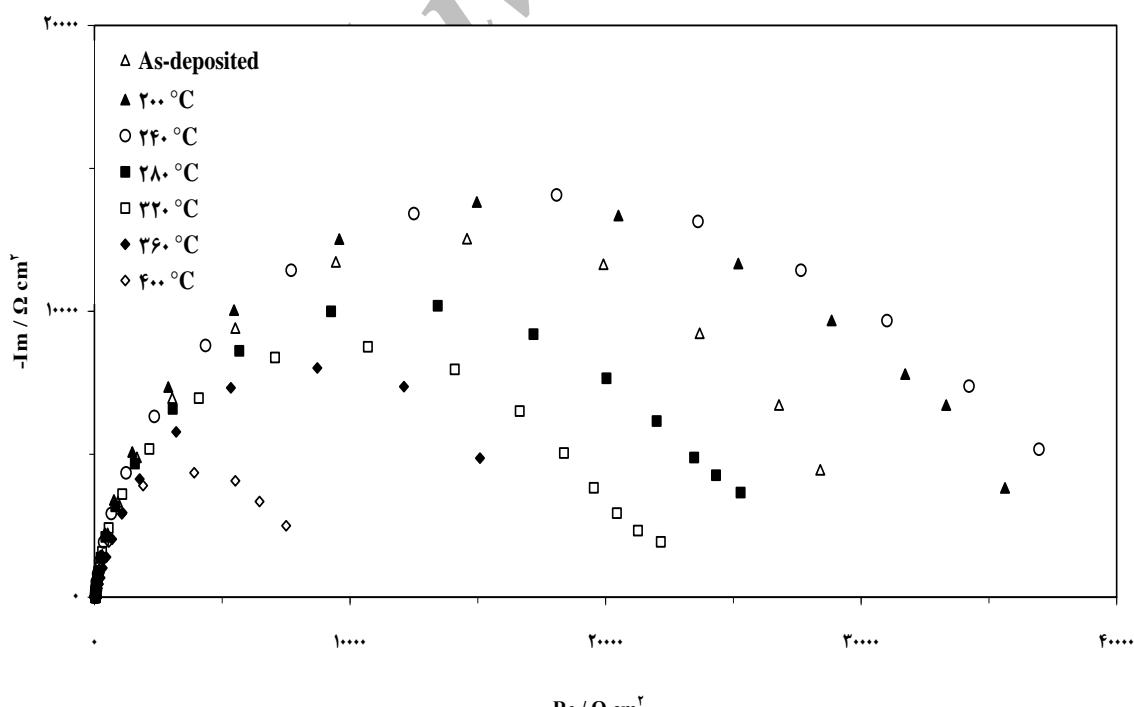
در اینجا لازم است از پژوهشکاره زیر دریایی (زیرسطحی) مالک اشترا شاهین شهر اصفهان که در امر تهیه نمونه های موردن آزمایش یاری رساندند و همچو نین آقای مهندس شکرالله حسنی که کمک فراوانی کردند سپاس و تشکر به عمل آید.

۲. پوشش اولیه، بازتاب‌های پهنی از اشعه ایکس را از خود نشان می دهد که نشان دهنده ساختار نیمه آمورف آن است. عملیات حرارتی، فاز آمورف را کاهش می دهد و پس از عملیات حرارتی در دمای 400°C و به مدت یک ساعت، فازهای تعادلی نهایی، کریستال های Ni_3P و Ni به ترتیب با اندازه‌های ۳۲ و ۱۸ نانومتر می‌باشند.

۳. عملیات حرارتی در دمای پائین (200°C) و به مدت یک ساعت) سبب کاهش ناچیزی در سختی سطح می‌شود. عملیات حرارتی از 360°C تا 240°C سبب افزایش سختی می‌گردد که بیانگر کریستالیزاسیون جزئی و در نتیجه، پیدایش عیوب مختلف کریستالی مربوط به آن است.

۴. عملیات حرارتی مناسب (200°C) و به مدت یک ساعت) ساختار پوشش را بهبود می بخشد و در نتیجه، مقاومت به خوردگی را افزایش می‌دهد.

۵. عملیات حرارتی در دمای بالا (400°C) و به مدت یک ساعت) سختی سطح را بهبود می بخشد اما



شکل ۵. منحنی‌های نایکوئیست پوشش‌های اولیه و عملیات حرارتی شده در دمای‌های مختلف و زمان یک ساعت، در محلول NaCl ، در پتانسیل $3/5$ در باز مربوط به آنها.

جدول ۱. پارامترهای خودرگی پوشش‌های اولیه و عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف و زمان یک ساعت، در محلول ۰.۵ wt.% NaCl

C_{dl} ($\mu\text{F cm}^{-2}$)	R_{ct} ($\text{k}\Omega \text{cm}^2$)	i_{corr} ($\mu\text{A cm}^{-2}$)	E_{corr} (mV vs. Ag/AgCl)	نوع پوشش
۲۹/۵۳	۲۹/۸۶	۰/۳۸۰	-۳۰۴	پوشش اولیه
۲۳/۱۶	۳۲/۹۳	۰/۲۸۸	-۲۷۲	پوشش عملیات حرارتی شده در ۲۰۰ °C
۲۱/۸۸	۳۴/۸۲	۰/۲۴۶	-۲۶۲	پوشش عملیات حرارتی شده در ۲۴۰ °C
۳۹/۳۸	۲۵/۵۰	۰/۳۹۸	-۳۱۴	پوشش عملیات حرارتی شده در ۲۸۰ °C
۳۱/۱۰	۲۰/۳۷	۰/۵۱۳	-۳۳۴	پوشش عملیات حرارتی شده در ۳۲۰ °C
۳۲/۴۹	۱۷/۶۱	۰/۶۹۲	-۳۴۸	پوشش عملیات حرارتی شده در ۳۶۰ °C
۳۶/۱۹	۷/۶۹	۱/۰۴۹	-۳۸۹	پوشش عملیات حرارتی شده در ۴۰۰ °C

مراجع

- Hu Yong-jun, Xiong Ling, Meng Ji-long, *Electron microscopic study on interfacial characterization of electroless Ni-W-P plating on aluminium alloy*, Applied Surface Science, 253 (2007) 5029-5034.
- Vishal Saxena, R. Uma Rani, A.K. Sharma, *Studies on ultra high solar absorber black electroless nickel coatings on aluminum alloys for space application*, Surface & Coatings Technology, 201 (2006) 855-862.
- W. Riedel, *Electroless Nickel Plating*, ASM International, Ohio, 1991.
- Gao Jiaqiang, Wu Yating, Liu Lei, Shen Bin, Hu Wenbin, *Crystallization temperature of amorphous electroless nickel-phosphorus alloys*, Materials Letters, 59 (2005) 1665-1669.
- T.S.N. Sankara Narayanan, K. Krishnaveni, S.K. Seshadri, *Electroless Ni-P/Ni-B duplex coatings: preparation and evaluation of microhardness, wear and corrosion resistance*, Materials Chemistry and Physics, 82 (2003) 771-779.
- Guofeng Cui, Ning Li, Deyu Li, Jian Zheng, Qinglong Wu, *The physical and electrochemical properties of electroless deposited nickel - phosphorus black coatings*, Coatings, Surface & Coatings Technology, 200 (2006) 6808-6814.
- K.G. Keong, W. Sha, S. Malinov, *Crystallization and phase transformation behaviour of electroless nickel-phosphorus deposits with low and medium phosphorus contents under continous heating*, Materials Science, 37 (2002) 4445-4450.
- Y. Gao, Z.J. Zheng, M. Zhu, C.P. Luo, *Corrosion resistance of electrolessly deposited Ni-P and Ni-W-P alloys with various structures*, Materials Science and Engineering A, 381 (2004) 98-103.
- Nicholas M. Martyak, Kerry Drake, *Peak-profile analysis of electroless nickel coatings*, Journal of Alloys and Compounds, 312 (2000) 30-40.
- Apachitei, J. Duszczyk, L. Katgerman, P.J.B. Overkamp, *Electroless Ni-P Composite Coatings: The Effect of Heat Treatment on the Microhardness of Substrate and Coating - Structure and Properties*, Scripta Materialia, 38 (1998) 1347-1353.
- J.N. Balaraju, S. Millath Jahan, Anjana Jain, K.S. Rajam, *Structure and phase transformation behavior of electroless Ni-P alloys containing tin and tungsten*, Journal of Alloys and Compounds, 436 (2007) 319-327.

12. Jeong-Won Yoon, Jong-Hyun Park, Chang-Chae Shur , Seung - Boo Jung , *Characteristic evaluation of electroless nickel-phosphorus deposits with different phosphorus contents*, Microelectronic Engineering, 84 (2007) 2552-2557.
13. K. Zangeneh-Madar, S.M. Monir Vaghefi, *The effect of thermochemical treatment on the structure and hardness of electroless Ni-P coated low alloy steel*, Surface & Coatings Technology, 182 (2004) 65-71.
14. T.S.N. Sankara Narayanan, I. Baskaran, K. Krishnaveni, S. Parthiban, *Deposition of electroless Ni-P graded coatings and evaluation of their corrosion resistance*, Surface & Coatings Technology, 200 (2006) 3438-3445.
15. Mustafa Anik, Erhan Korpe, *Effect of alloy microstructure on electroless NiP deposition behavior on Alloy AZ91*, Surface & Coatings Technology, 201 (2007) 4702-4710.
16. K.G. Keong, W. Sha, S. Malinov, *Hardness evolution of electroless nickel-phosphorus deposits with thermal processing*, Surface & Coatings Technology, 168 (2003) 263-274.
17. Yong-jun Hu, Tian-xu Wang, Ji-long Meng, Qian-yang Rao, *Structure and phase transformation behaviour of electroless Ni-W-P on aluminum alloy*, Surface & Coatings Technology, 201 (2006) 988-992.
18. Y.Z. Zhang, Y.Y. Wu, M. Yao, *Characterization of electroless nickel with low phosphorus*, Materials Science Letters, 17 (1998) 37-40.